#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06348820 A

(43) Date of publication of application: 22.12.1994

(51) Int. CI

G06F 15/62

G01N 21/88, H05K 3/28

(21) Application number:

05137656

(22) Date of filing:

08.06.1993

(71) Applicant: HITACHI LTD

(72) Inventor:

TANAKA HIROMI

**FUJIWARA YASUYUKI SEKIYAMA YUTAKA** HATAKEYAMA KAZUMI

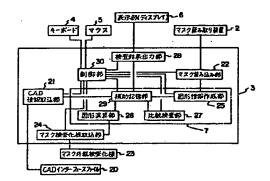
### (54) APPEARANCE INSPECTION DEVICE FOR MASK FOR PRINTED WIRING BOARD

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve reliability for a mask for printed wiring board.

CONSTITUTION: This device is comprised of a mask reader 2 which fetches the pattern of a mask to be inspected as bit map information, a mask inspecting specification fetching part 24 which fetches the appearance inspecting specification of the mask, a CAD information fetching part 21 which fetches CAD information when the mask is generated, a graphic information generating part 25 which converts the bit map information to graphic information including the external shape of a pattern, a graphic arithmetic part 26 which performs arithmetic processing for the superimposed state of the patterns of the masks in different layers, the minimum width of the pattern, and a gap between the patterns, etc., setting at least the graphic information obtained at the graphic information generating part 25 and fetched mask inspecting specification as input, a comparison inspecting part 27 which detects the disconnection and short-circuited part of the mask pattern setting at least the graphic information obtained at the graphic information generating part 25 and fetched CAD information as input, and a display part 6 which outputs the processing results of the graphic arithmetic part 26 and the comparison inspecting part 27.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO



## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-348820

(43)公開日 平成6年(1994)12月22日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	<b>广内整理番号</b>	FΙ	技術表示箇所
G06F	15/62	405	A 9287-5L		
G01N	21/88	1	F 8304 – 2 J		
H05K	3/28	1	B 7511-4E		

#### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 16 頁)

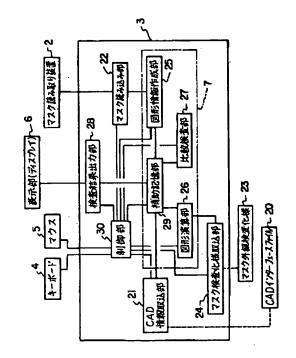
		II 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		
(21)出願番号	特願平5-137656	(71)出願人	000005108	
			株式会社日立製作所	
(22)出願日	平成5年(1993)6月8日	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地		
	er i	(72)発明者	田中宏美	
	·		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	
			式会社日立製作所日立研究所内	
		(72)発明者	藤原 康之	
		1	茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	
			式会社日立製作所日立研究所内	
		(72)発明者	関山 裕	
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	
			式会社日立製作所日立研究所内	
		(74)代理人	•	
			最終頁に続く	

#### (54) 【発明の名称】 プリント配線板用マスクの外観検査装置

### (57)【要約】

【目的】 プリント配線板用マスクの信頼性の向上

被検査マスクのパターンをピットマップ情報 として取り込むマスク読み取り装置2と、マスクの外観 検査仕様を取り込むマスク検査仕様取込部24と、マス ク作成時のCAD情報を取り込むCAD情報取込部21 と、前記ピットマップ情報をパターンの外形形状を含む 図形情報へ変換する図形情報作成部25と、少なくとも 該図形情報作成部25で得られた図形情報及び前記取り 込まれたマスク検査仕様を入力として、異なる層のマス クのパターンの重なり状態、パターンの最小幅、及びパ ターン間の間隙等の演算処理をする図形演算部26と、 少なくとも前記図形情報作成部25で得られた図形情報 及び前記取り込まれたCAD情報を入力としてマスクバ ターンの断線、短絡個所を摘出する比較検査部27と、 前記図形演算部26と前記比較検査部27の処理結果を 出力する表示部6とを含んで構成されたプリント配線板 用マスクの外観検査装置。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 プリント配線板用マスクの外観検査装置において、マスク検査仕様の取り込み手段と、マスク作成用CAD情報の取り込み手段と、マスク作成用CAD情報の取り込み手段と、読み込んだマスク情報をパターンの外形形状を含む図形情報へ変換する図形情報作成手段と、少なくとも該図形情報作成手段で得られた図形情報及び前配取り込まれたマスク検査仕様を入力として、異なる層のマスクのパターンの選なり状態、パターンの最小幅、及びパターン間の間 10 隙等の演算処理をする図形演算手段と、少なくとも前配図形情報作成手段で得られた図形情報及び前記取り込まれたCAD情報を入力としてマスクの欠陥個所を摘出する欠陥個所摘出手段と、前記図形演算手段と前記欠陥個所摘出手段の処理結果を出力する表示手段とを備えたことを特徴とするプリント配線板用マスクの外観検査装置。

【糖求項2】 請求項1に記載のプリント配線板用マスクの外観検査装置において、欠陥個所摘出手段は、図形情報作成手段で得られた図形情報と前記取り込まれたCAD情報を入力として、同一層内におけるマスクの欠陥個所の摘出及び各層間でのマスク欠陥個所の摘出を行うものであることを特徴とするプリント配線板用マスクの外観検査装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載のプリント配線 板用マスクの外観検査装置において、欠陥個所摘出手段 は、配線パターンの短絡及びまたは断線の有無を検出す るものであることを特徴とするプリント配線板用マスク の外観検査装置。

【請求項4】 請求項1乃至3のうちのいずれかに記載のプリント配線板用マスクの外観検査装置において、図形演算手段は、図形情報作成手段で得られた図形情報と前記取り込まれた検査仕様を入力として、配線パターン内部に包含される図形を検出し、該検出された図形がスルーホールかそうでないかを検出する手段をも有するものであることを特徴とするプリント配線板用マスクの外観検査装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プリント配線板のマスク外観欠陥を検査するマスク外観検査装置に係り、特に高密度でファイン化するプリント配線板のマスクの外観欠陥の検査もれ低減を図った、マスク外観欠陥個所を自動検出するマスク外観検査装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】プリント配線板作成用マスクには、配線パターンや、上下に重ねられる配線パターンを所定の位置で相互に接続するスルーホールが形成されている。これらの配線パターンやスルーホールは、通常、CADシステムにより描画され、この描画に基づいて原寸大のマ 50

スクが作成される。そして先に述べたように、マスク製作後に、製作段階で生ずるマスクのパターン切れ(断線)、突起、パターン幅の過少、パターン相互間の短絡、異物の付着、ピンホール等の外観異常が検査される。この外観欠陥は、マスク作成時に人為的、機械的に発生する欠陥と、マスクに付着したゴミを含んでいる。図3は、マスクの外観欠陥の例を示すもので、例えば、欠け11、突起12、13、ピンホール14、シルクマスクとスルーホール穴への垂れ込み15等がある。

2

【0003】大部分のプリント配線板のマスクの、配線 を示すパターン幅、パターン間隙、ランド/穴径は1/ 100mm精度の微細なパターンで描かれている。従来 のマスク検査では、検査者がマスク上を一定の間隔でレ ンズをスライス状に移動させ、レンズで拡大されたマス ク描画を目視し、マスクのパターン切れ、突起、パター ン幅の過少、パターン相互間の短絡、異物の付着、ピン ホール等の外観異常を摘出している。また詳細な寸法は 検査者が測長器で計測する。一方、LSIのマスク外観 検査では比較照合方式で欠陥検査が行われている。その 検査方法はレンズを用いた光学装置でマスク情報を読み 取り、これを光電変換器で電子情報に変換する。これを チップ同志で互いに比較照合し異差を検出する方法、標 準マスクと比較する方法、設計データと比較する方法な どがある。しかしこれらはいずれも外観検査用の高価な 装置を必要とするものであった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の技術は、プリント配線板作成用マスクの外観欠陥検査を人間の目視に頼る方法であるため、欠陥を見落とす可能性があり、かつ自動化の配慮がなされておらず、時間と労力を要するわりに外観検査の信頼性が十分確保されていなかった。

【0005】特開昭63-143677号公報には、電 子回路基板上に実装された部品の画像データをカメラで 取り込み、取り込まれた画像データから当該部品の種 類、方向等の部品情報を検出し、記憶手段に格納されて いる前記電子回路基板上に実装された部品の部品情報と 比較して当該部品の正誤を判別する検査装置が開示され ている。しかし、この装置では、電子回路基板上に実装 された部品の部品情報を記憶手段に予め格納する必要が あり、その格納のための手間が増えることや格納段階で の誤入力の問題があったし、配線自体のパターンに短 絡、断線や、隣接する配線間の間隔の過少、配線幅の過 少などの検査については触れられていない。また、特開 平1-236379号公報には、検査対象の部品のCA Dデータを予めメモリに格納しておき、実装済基板上の チップ部品をカラーテレビカメラで撮像し、得られた信 号を3原色別々にデジタル信号に変換し、このデジタル 信号を用いてチップ部品のエッジの位置を検出し、得ら れたエッジ位置と前記メモリに格納されたCADデータ

を比較して当該部品の位置ずれの有無を検出する装置が 開示されている。この装置においても、配線自体の検査 については触れられていないし、CADデータは配線パ ターンなどの場合、中心線基準になっていて外形線が表 示されておらず、パターン間の間隔やパターンの幅の検 出には不適当である。

【0006】本発明の目的は、プリント配線板作成用マ スクの信頼性、特に配線パターンの信頼性を高めること にある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的は、マスク検査 仕様の取り込み手段と、マスク作成用CAD情報の取り 込み手段と、マスクのパターンをマスク情報として読み 込むマスク読み込み手段と、読み込んだマスク情報をパ ターンの外形形状を含む図形情報へ変換する図形情報作 成手段と、少なくとも該図形情報作成手段で得られた図 形情報及び前記取り込まれたマスク検査仕様を入力とし て、異なる層のマスクのパターンの重なり状態、パター ンの最小幅、及びパターン間の間隙等の演算処理をする 図形演算手段と、少なくとも前記図形情報作成手段で得 られた図形情報及び前記取り込まれたCAD情報を入力 として、マスクの欠陥個所を摘出する欠陥個所摘出手段 と、前記図形演算手段と前記欠陥個所摘出手段の処理結 果を出力する表示手段とを備えたプリント配線板用マス クの外観検査装置により達成される。

【作用】プリント配線板の各マスクのパターンは、マス ク読み取り手段によりピットマップ情報として取り込ま れる。これらピットマップ情報は図形情報作成手段によ りポリゴン図形情報に変換され、補助記憶装置に層ごと に整理、格納される。一方、マスク作成時のCAD情報 から信号ごとの接続点座標が取り込まれ、補助記憶装置 に信号ごとに整理、格納される。マスク検査仕様はマス ク検査仕様の取り込み手段により取り込まれ格納され

【0009】次に図形演算手段により、設定されたマス ク検査順序に従って、単一の該当層あるいは複数の該当 層の図形情報が取りだされ、検査のための外形データの 演算が行われる。マスクのパターン外形に生じた突起に 起因する欠陥は図形の外形線間の間隙演算により、パタ 40 ーン間の間隙不良として検出され、マスクの欠けに起因 する欠陥は図形の最小幅演算により検出される。マスク のピンホールに起因する欠陥は図形の最小幅演算により 検出される。一方図形の中に他の図形を包含している包 含図形の有無からもピンホールは検出される。シルクマ スクのスルーホール穴への垂れ込みに起因する欠陥はシ ルク層と当該層の層間における図形の重なりから検出さ れる。

【0010】また、欠陥個所摘出手段により、CAD情

図形情報の重なりから生成された信号経路との比較照合 が行われ、短絡、断線が検出される。

【0011】これらの検査結果は表示手段に表示され

#### [0012]

【実施例】以下、本発明の具体的実施例について詳細を 説明する。

【0013】図1は本発明の実施例であるマスク外観検 査装置の主要な構成要素を示すプロック図である。図1 10 に示すマスク外観検査装置は、コピー機、ファクシミリ 等で使用される8~16ドット/mmの解像力を持つ電 子線走査読み取り機であるマスク読み取り装置2と、該 マスク読み取り装置2の出力側に接続された集中制御機 能を持つ集中制御処理装置3と、該集中制御処理装置3 に接続されたキーボード入力装置4及びマウス入力装置 5と、前記集中制御処理装置3に接続されて表示手段を なすディスプレイ出力装置6とを含んで構成されてい る。マスク読み取り装置2はプリント配線板製作用マス ク(以下、被検査マスクという)1のパターンを読み取 るものである。

【0014】集中制御処理装置3は、CADインターフ ェースファイル20に格納されたデータを取り込むCA D情報取り込み部21と、該CAD情報取り込み部21 に接続されCAD情報取り込み部21が取り込んだデー 夕を格納する補助記憶部29と、前配マスク読み取り装 置2の出力側に接続され酸マスク読み取り装置2の出力 を格納するマスク読み込み部22と、入力側を該マスク 読み込み部22に接続され出力側が前記補助記憶部29 に接続された図形情報作成部25と、前配補助配億部2 9に接続された図形演算部26と、同じく前配補助記憶 部29に接続されて欠陥個所摘出手段をなす比較検査部 27と、前記図形演算部26に接続されたマスク検査仕 様取り込み部24と、これら各構成要素20~29の動 作を制御するとともに、前記キーボード4及びマウス5 に接続して配置されそれらから入力される信号に基づい てこれら各構成要素20~29の動作を制御する制御部 30とを含んで構成されている。

【0015】 図形情報作成部25、図形演算部26、比 較検査部27及び補助記憶部29を含んで演算処理部7 が構成される。

【0016】図2は図1に示すマスク外観検査装置のハ ード構成の例を示す斜視図である。図示の例では、CA D情報およびマスク検査仕様はあらかじめフロッピーデ ィスクに格納され、制御処理装置3のディスクドライブ を介して該フロッピーディスクから制御処理装置3内の CAD情報取り込み部21とマスク検査仕様取り込み部 24に送りこまれるようになっている。

【0017】図3は、本発明のマスク外観検査装置の検 査対象となるマスクの外観欠陥の例を示すもので、この 報の信号ごとの接続点情報と、被検査の該当層マスクの 50 外観欠陥は、マスク作成時に人為的、機械的に発生する

欠陥と、マスクに付着したゴミを含んでいる。外観欠陥 として、先に述べたように、例えば、欠け11、突起1 2、13、ピンホール14、シルクマスクとスルーホー ル穴への垂れ込み15等がある。

【0018】以下、上記構成のマスク外観検査装置の動 作を図4、5、6を参照して説明する。プリント板CA Dシステムのインターフェースファイル20には、信号 の接続点情報、部品情報、スルーホール情報、配線経路 情報、信号テーブル、ピンピンテーブルなどのマスク作 成時の実装情報 (CAD情報) が格納されている。CA 10 D情報取り込み部21は、インターフェースファイル2 0のCAD情報を取り込み補助記憶装置29に格納す る。マスクの外観検査仕様23には、部品面、はんだ面 等のマスク層の指定、突起の判断基準のパターン間隙 長、欠けの判断基準のパターン最小幅等、具体的な欠陥 の判断基準値等が含まれ、マスク検査仕様取り込み部2 4がこれらの情報の取り込み、格納を行う。マスク読み 取り装置2は、製作された被検査マスク1のパターンを 電子線走査読み取りにより読み込んで、電気信号のビッ トマップ情報に変換する。図4のパターン31、図5の 20 パターン34、図6のパターン38から、図4のピット マップ情報32、図5のピットマップ情報36、図6の ピットマップ情報39がそれぞれ得られる。得られたピ ットマップ情報は、マスク読み込み部22に格納され

【0019】図形情報作成部25は、マスク読み込み部 22に格納された図4、図5、図6に示すピットマップ 情報32,36,39から、それぞれのパターンの外形 の輪郭(穴がある場合は穴形状を含め)を示すポリゴン の図形情報 3 3, 3 7, 4 0 を作成し、得られた図形情 30 報を各マスク層ごとに補助記憶部29に登録、格納す る。

【0020】図形演算部26は、補助記憶部29から格 納された図形情報を読み出し、図7に示す重なり演算、 図8に示す最小幅演算を行う。図7に示す重なり演算 は、1枚のマスク内での2図形の交差関係を求めるもの で、(1) は交差の関係、(2) は包含の関係、(3) は分離の関係を示している。図7の(2)、(3)は、 更に2図形間の最短距離の間隙長しを求めるものであ る。図8に示す最小幅演算は、図形内で最もくびれたと 40 ころの最小幅しを求めるものである。重なり演算、最小 幅演算で得られた結果が、マスク検査仕様取り込み部2 4 に格納された検査仕様と照合され、欠陥の有無が判定 される。判定結果は前記補助記憶部29に格納される。 ここでは、マスクのパターンの突起が図形間の間隙長が 仕様を下回っていないかどうかによるチェック、マスク の欠けが図形の最小幅が仕様を下回っていないかどうか によるチェック、マスク内のピンホールが図形の包含の 関係のチェックにより、それぞれ検出される。スルーホ ール穴への垂れ込み欠陥は、図9の例から(1)シルク 50 夕もしくはキャラクタデータとして表示部28に出力す

マスク層とレジストマスク層の複数層を対象とし、 (2) 異なる層の間における図形の重なりチェックから 検出される。

【0021】比較検査部27では、配線パターンの断 線、配線パターンの短絡の有無が、前記補助記憶部29 から読みだされた図形情報とCAD情報に基づき検出さ れ、検出結果が前配補助配憶部29に出力、格納され る。ここでは、突起、ゴミ等によるパターンの短絡、欠 けによるパターンの断線が、マスク情報の論理接続チェ ックを行うことにより検出される。パターンの短絡、断、 線の検出を図10、11を例にとって説明する。まず、 CAD情報から信号毎の接続点(S1信号はP1、P2 の2点接続、S2はP3、P4の2点接続)、穴の貫通 情報が取り込まれ、接続点テーブル1004が生成され る。次に補助記憶部29のマスク情報から部品面とはん だ面の図形情報1005、1006を用いてX-Y平面 における図形の重なりが求められ、CAD情報からの穴 の貫通情報1007を用いて層間が接続され配線経路が 生成される。得られた配線経路から、接続点テープル1 008が生成される。正常マスクの例では、CAD情報 から取り込まれた信号、接続点(S1信号はP1、P2 の2点接続、S2はP3、P4の2点接続)が、マスク 情報から求められた配線経路の信号、接続点(S1はP 1、P2の2点からなり、S2はP3、P4の2点から なる)と同じであり、欠陥(短絡、断線)は検出されな

【0022】図11に示された短絡マスクの例は、P 1、P3の短絡により、1図形内に複数信号の接続点が 包含される場合で、マスク情報から生成された接続点テ ープル1104の配線経路の信号、接続点(S1はP 1、P2、P3、P4の4点からなる) がCAD情報の 信号数より少く、両者が一致しないことから短絡の存在 が検出される。同じく図11に示された断線マスクの例 は、P3、P4経路の断線からS2信号が分断される場 合で、マスク情報から生成された接続点テーブル110 8の配線経路の信号、接続点 (S1信号はP1、P2の 2点接続、S2はP3、S3はP4の各1点接続からな る)がCAD情報の信号数より多く、両者が一致しない ことから断線が検出される。

【0023】接続検査では以上の3通りをチェックする ことから欠陥の有無が判断される。ここでは2層のマス クを用いた事例について述べたが、多層のマスクについ ても同様な方法で検査が行われる。検査結果は前記補助 記憶部29に出力され、格納される。

【0024】図形演算部26及び比較検査部27の演算 が終了すると、制御部30は、検査結果出力部28に対 して検査結果の出力を指示し、検査結果出力部28はこ の指示を受けて補助記憶部29から検査結果を読みだし て、マスクの異常の有無と欠陥個所を表示する画像デー

る.

【0025】マスクの外観検査結果の表示部28は、入力された画像データもしくはキャラクタデータを画面に表示する。本実施例では、検査結果を画面表示するように構成されているが、プリンタによる出力としてもよい。

【0026】図12にマスク外観検査の処理フローの例を示す。まず、CADインターフェースファイル20からCAD情報が取り込まれて格納され(ステップ1201)、マスク検査仕様が取り込まれて格納(ステップ1201)、マスク検査仕様が取り込まれて格納(ステップ1201)202)される。次に製作された被検査マスク1のパターンが読み込まれ(ステップ1203)、ビットマップに変換され(ステップ1204)でマスク読み込み部22に格納される。その際、同一配線板を構成するマスクは一つのグループとして、かつ重なる順序がわかるように格納される。次にマスク読み込み部22に格納されたビットマップからポリゴン図形情報が生成され、補助記憶部29に格納、登録される(ステップ1205)。ステップ1203からステップ1205までは、自動的に実行される。

【0027】被検査マスク1の読み込みが終了し、キー 20ポード4から検査開始の指示が入力されると、補助記憶部29に格納、登録されたポリゴン図形情報に基づいてパターン間の間隙計算が行われて突起の有無のチェックが行われ(ステップ1206)、次いで図形の包含関係が演算されてピンホールの有無がチェックされる(ステップ1207)。ステップ1208で配線パターンの最小幅計算が行われてパターンの欠けの有無がチェックされ、次いでマスク間の交差計算が行われてスルーホールへの他の図形の垂れ込みの有無がチェックされる(ステップ1209)。ステップ1206からステップ1209までの処理は図形演算部26により行われ、各ステップごとに演算結果がマスク検査仕様取り込み部24に格納された検査仕様に照合されて欠陥であるかどうかが判定される。判定結果は補助記憶部29に格納される。

【0028】次に、先に述べた手順により、パターン間の交差計算が行われて配線パターンの断線、短絡の有無がチェックされ、判定結果が補助記憶部29に格納される(ステップ1210)。ステップ1210の処理は、比較検査部27により実行される。

【0029】読み込まれたすべての被検査マスク1につ 40 いて上述のステップ1206からステップ1210までが終了すると、制御部30から判定結果表示が指示され、マスク欠 陥個所が画面表示される (ステップ1211)。

【0030】上記実施例では、ステップ1206~1209の処理の終了後、ステップ1210の処理がおこなわれるようになっているが、ステップ1206~1209の処理は図形演算部26で、ステップ1210の処理は比較検査部27で、それぞれ行われるので、ステップ1206~1209の処理とステップ1210の処理を並行して行うようにしてもよい。

【0031】以上のように本実施例では、マスクの読み 50

取りから図形情報への変換、図形の幾何計算による欠陥 検査までが計算機による演算で行われるので、人の目視 検査に頼る部分が少なくなり、検査者の工数が低減され るとともに検査結果の信頼性が向上する。

【0032】次に、ピットマップ情報からポリゴンの図形情報を生成する手順と、図形の重なり包含チェック及び図形間の間隙演算処理手順と、同一図形内の最小幅演算処理手順と、断線、短絡検出処理手順と、を図面を参照して詳細に説明する。

【0033】まず、ピットマップ情報からポリゴンの図 形情報を生成する手順を、図13、14を参照して説明 する。図14に示された手順は、前配図12に示された ステップ1203~1205の処理手順に相当する。まず、読み 取り装置2で被検査マスク1のパターン34が読み込ま れ、1,0のピットマップ情報36に変換される(140 1)。次に1が1にセットされ(1402)、ピットマップ 情報36のX座標1が1である、Y列方向のピットマッ プ情報が取り出される(1403)。取り出されたY列方向 のピットマップ値のうち、1の連続する走査線を1線分 とし、Y方向の線分化が行われる(1404)。 X座標 i が 1 である、Y列方向のビットマップ情報の線分化処理が 終わるとiがi+1にセットされ(1405)、ピットマッ プ情報36の全てのX座標について線分化処理が終了し たかどうかが確認される (1406) 。終了していなければ 手順1403~1406の手順が繰り返される。終了していれ ば、手順1407に進む。この段階で、線分化されたビット マップ情報36Aが得られる。

【0034】手順1407ではiが1にセットされる(140 7)。次いでX座標が1である線分とX座標が1+1で ある線分において、Y座標上で接しあう(重なりあう) 線分を外周が時計回り方向となる閉図形とする。 Y座標 上で接しあう線分からできる矩形を対象にその矩形の頂 点を座標とする時計回り方向の閉図形とする。図13に おいて、例えば線分P3P4と線分P5P6、P7P8 を対象にした場合、P5P6とP7P8の2線分はとも に線分P3P4に接し、P1P2, P3P4, P5P 6. P7P8の各線分からなる矩形ができる。次に線分 P3P4上の点PaはP6のY座標、点PbはP7のY 座標とし、矩形の頂点とPa, Pbからなる時計回りの 閉図形P2P4P8P7PbPaP6P5P3P1が形 成される。すなわち、X座標がiである線分がすでに閉 図形の一部であるときは、該閉図形が、X座標がi+1 である線分の分だけ拡大された形の閉図形となるよう に、閉図形の形状を更新する (1408)。上記の例でいう と、線分P3P4は、すでに閉図形P2P4P3P1の 一部であるから、新たな閉図形は、もとの閉図形P2P **4P3P1を線分P5P6、P7P8の分だけ拡大して** できる閉図形P2P4P8P7PbPaP6P5P3P 1となる。

50 【0035】上記処理で時計回り閉図形の内側に反時計

回りの閉図形が形成された場合、それを時計回り閉図形 の窓図形とし、図形として認知する(1409)。すなわ ち、前記手順1408を実行した結果、例えば図13におい て、閉図形P2P4P8P12P11P7PbPaP6 P10P9P5P3P1が形成され、つぎの処理で線分 P14P13を処理する場合、閉図形P2P4P8P1 2P14PdPcP13P9P5P3P1が形成され、 同時に閉図形PbP7P11PdPcP10P6Paが 形成されるのである。

【0036】実際には同一X座標上には複数の線分が断 10 続して存在する。これら線分において接しあう既閉図形 が無い場合は、新規の閉図形とし(1410)、上記基 本処理に沿って閉図形が1個増すこととなる。

【0037】手順1410が終わると、1が1+1にセット され (1411) 、すべてのX列方向の線分が処理されたか どうかがチェックされる (1412)。終了していなけれ ば、手順1408~1412の処理が繰り返される。終了してい れば、ピットマップ情報のポリゴン図形情報化は終了す る。この段階で、図13に例示するポリゴン図形情報3 7が得られ、このデータは補助記憶部29に格納され 20

【0038】次に図15、16を参照して図形の重なり 包含チェック及び図形間の間隙演算処理手順を説明す る。図16に示された手順は、前記図12に示されたス テップ1206~1207の処理手順に相当する。以下の説明に おける図形は、ポリゴン図形情報として補助記憶部29 に格納された図形である。図15に示す二つの図形A, Bを例にとって説明する。まず、2図形A、Bにおい て、それを包含する矩形 (A', B') が重なっている かどうかがチェックされる (1601)。矩形 (A', B')は、図形A、Bが内接する矩形よりもパターンの 許容最小間隙δだけ大きくしてある。矩形(A', B') が重なっていない場合、図形A, Bの重なりはな いと判定され、その旨の判定結果が出力され、当該図形 の重なりチェックは終了する。矩形 (A', B') が重 なっている場合、図形Aの外形を構成する線分(以下、 要素という) a i (i=1~4) と図形Bの外形を構成 する線分である要素 b j (j=1~8)の交点の有無が チェックされる(1603)。交点が存在する場合、図形 A, Bが互いに重なっていると判定され、その旨の判定 40 結果が出力され当該図形の重なりチェックは終了する。

【0039】交点が存在しない場合、手順1605に進み、 図形A、Bのいずれかが他方の内にあるのかどうかが判 定される。図形A、Bがいずれも他方の外側にある場合 (包含関係にない場合)、要素 a 1 と要素 b 」間の間隙 長が算出される (1606)。 図15に、要素a3と要素b 8の間隙長の算出例を示す。このような演算が各要素の 組合せについて行われる。間隙長が算出されたら、間隙 長が検査仕様を満たしているかどうかが判定される (16 07) 。間隙長が検査仕様を満たしている場合、重なりは 50 点P2に伝わり、マスクAの接続点P2に入った信号S

ないと判定され、その旨の判定結果が出力される。間隙 長が検査仕様を満たしていない場合、欠陥(間隙長不 足) と判定され、欠陥が発生しているマスクを指定する **層名、間隙が不足している区間及び間隙長が出力される** (1608) .

10

【0040】手順1605で、図形A, Bのいずれかが他方 の内にあると判定された場合(包含関係にある場合)、 内側図形が検査仕様(例えばスルーホールの条件を規定 する寸法仕様) を満たしているかどうかがチェックされ (1609) 、検査仕様を満たしていなければピンホールと 判定されて、ピンホール警告(欠陥が発生しているマス クを指定する層名と内側図形)が出力される(1610)。 【0041】次に図17、18を参照して、同一図形内 の最小幅演算処理手順を説明する。図18に示された手 順は、前記図12に示されたステップ1208の処理手順に 相当する。以下の説明における図形は、ポリゴン図形情 報として補助記憶部29に格納された図形である。ま ず、補助記憶部29から検査対象の図形のデータが、あ らかじめ定められた順序にしたがって取り出される。図 17に本実施例で説明する検査対象の図形を示す。この 図形は要素 a i (i=1~9)で外形が規定され、要素 a3(もしくは要素a4)と要素a8の間が最小幅hと なっている。次いで、i=1に設定され(1801)、図形 を構成する要素ai(i=1~9)と、該要素aiの前 後の要素 a (i±1) を除く他の要素間の間隙長が求め られる (1802) 。例えば、要素 a 3 の場合、要素 a 5 と の間隙長h5、要素a6との間隙長h6、要素a7との 間隙長 h 7, 要素 a 8 との間隙長 h 8, 要素 a 9 との間 隙長h9がそれぞれ算出される。各図形について各間隙 長の許容最小値(例えばa3要素についてMinb5, Min h6, Minh7, Minh8, Minh9) が検査仕様として設定さ れており、ある要素aiについての間隙長算出が終了し たら、算出された間隙長が検査仕様を満たしているかど うかが判定される(1803)。間隙長が検査仕様を満たし ていればそのまま手順1805に進み、検査仕様を満たして

【0042】手順1805では、i=i+1に設定され、次 の手順1806に進む。手順1806では、全要素間の間隙長検 査が終了したかどうかがチェックされ、終了していれば 当該図形の処理終了となり、終了していなければ手順18 02~1806が繰り返される。

いない場合は、最小幅不足と判定され、当該マスクの

層、幅が不足している区間及び幅が出力(1804)された

のち、手順1805に進む。

【0043】次に、断線、短絡検出処理手順を図19, 20,21を参照して詳細に説明する。図21に示した 処理手順は、図12のステップ1210に相当する。図19 に断線、短絡検出処理の対象である配線パターンの例を 示す。図示の配線パターンは、マスクAの接続点P1に 入った信号S1はスルーホールCを経てマスクBの接続

12

2はスルーホールDを経てマスクBの接続点P4に伝わるようになっている。このマスクのCAD情報は、図20に配載されているように、信号テーブルとピンピンテーブルとからなっている。信号テーブルは該当マスクに流れる信号名S1,S2と、該信号名が格納されるアドレスを示すポインタを含んでいる。ピンピンテーブルは接続点P1~P2と、該接続点に流れる信号名S1,S2と、接続点と信号名の組合せに対応するポインタとを含んでいる。図20で、P1,S1の組合せに対応するポインタ2からP2,S1の組合せに対応するポインタ 100に矢印が付されているのは、P1,S1の組合せとP2,S1の組合せが同じグループに属し、同じ信号がながれることを示している。ポインタ0はそのほかには同じグループに属する接続点と信号名の組合せがないことを示している。

【0044】処理手順としては、まず、互いに重ね合わ せられる関係にあるマスクのうちの最初のマスクについ て、マスクから生成された1閉図形を1グループとする グループテーブルと接続点テーブルが作成され(210 1) 、順次重ね合わせられる関係にあるマスクから生成 20 された閉図形がスルーホールを通して層間のグループ接 統が行われる (2102)。ここでいう閉図形は、先に図1 3, 14を参照して説明した手順で生成されたポリゴン 図形情報で規定される図形である。また、グループテー ブルに含まれるグループ数が算出され、グループ数nが セットされる。マスクのパターンが正常で断線、短絡等 の欠陥がない場合、グループテーブル2003と接続点 テーブル2004が作成される。なお、接続点と信号名 の組合せは、ピンピンテーブル2002に規定されたデ ータが用いられる。P1, S1の組がスルーホールを介 30 してP2、S1の組につながっているので、P1、S1 の組のポインタ2からP2, S1の組に矢印が付けら れ、P2, S1の組はもう他の組につながっていないの で、ポインタ0が付けられている。

【0045】次に、グループテーブルから最初のグルー ブが取り出され、グループテーブルのグループ数を示す nがn-1にセットされる (2103)。取り出されたグル ープに属する接続点の信号名が同じかどうかが、接続点 テーブルでチェックされる (2104~2106) 。同じでなけ れば、図形が短絡していると判定され、短絡の表示と含 40 まれている信号名が出力される(2112)。そのグループ に属する接続点の信号名がみな同じであれば、次の手順 2108に進む。手順2108では、CAD情報のピンピンテー ブルから信号名が手順2103~2106でチェックされたと同 じである接続点の数(ピンピン数)が読みだされ、読み だされたピンピン数と接続点テーブルの前記グループの 接続点の数が同じかどうかがチェックされる (2109)。 同じであれば、当該グループには断線、短絡はないと判 断されて次の手順2113に進み(2111)、同じでなけれ ば、断線していると判断されて断線の表示と該当する信 50 図である。

号名が出力され、次の手順2113に進む (2110)。手順21 13では、グループテーブルのグループ数を示すnがn=0かどうかが確認され、n=0であれば処理が終了し (図12のステップ1212に進む)、n=0でなければ、手順2103~2113の処理が繰り返される。手順2110, 2112 で出力された信号は、前記補助記憶部29に該当するマスクを示す信号とともに格納、記憶される。

【0046】本発明によれば、これまでに説明したように、部品面、半田面、電源面、シルク面、レジスト面など複数の層に分かれているマスクの相互の関連が、図形の重なり演算により自動的に確認でき、人が目視によって検査する場合の見落としを極減することができる。また、パターン読み込み装置によって読み込まれたデータからマスクパターンの外形を演算して求め、得られた実際のパターンの外形線に基づいてパターンの間隔や幅を検知するので、マスクの製造過程で発生したパターンの突起や欠けに起因する欠陥をひとの目視によることなく、検出できる。また、前記演算によって得られた外形とCAD情報から得られる接続点を組み合わせ、CAD情報から得られる接続点と信号名の組合せと照合することにより、配線パターンの短絡、断線などの欠陥をも人の目を介することなく検出できる。

#### [0047]

【発明の効果】本発明によれば、ビット情報として読み込まれたマスクパターンがポリゴン図形情報に変換され、このポリゴン図形情報を用いてパターンの外形線の間隔、異なる層間でのパターンの重なり、パターンの寸法のチェックや、ポリゴン図形情報から得られる接続点情報とCAD情報から得られる接続点情報との照合などが行われるので、高密度化、微細化するマスクパターンの外観検査が自動化でき、人為的、機械的に発生する微細なマスクの欠陥、ゴミ、層間の位置ずれ等を的確に、短時間に、漏れなく検出できる。その結果、プリント板製造における品質確保及び信頼性向上とともに、検査工数低減の効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のマスク外観検査装置の実施例の要部構成を示すプロック図である。

【図2】図1に示す実施例のハードウエア構成例を示す 斜視図である。

【図3】マスク外観検査の対象となる外観欠陥の例を示す平面図である。

【図4】マスクパターンの例とそれから得られるピットマップ及びポリゴン図形の例を示す平面図である。

【図 5】 ピンホールを含むマスクパターンの例とそれから得られるピットマップ及びポリゴン図形の例を示す平面図である。

【図 6】文字フォントのマスクパターンの例とそれから 得られるピットマップ及びポリゴン図形の例を示す平面 図である。 13

【図7】本発明の実施例における図形演算機能の例を示 す平面図である。

【図8】本発明の実施例における図形演算機能の他の例 を示す平面図である。

【図9】本発明の実施例における異なる層の間での図形 演算機能の例を示す平面図である。

【図10】本発明の実施例における短絡、断線の検出手 順の例を説明する図である。

【図11】本発明の実施例における短絡、断線の検出手 順の例を説明する図である。

【図12】本発明の実施例におけるマスク外観検査の処 理手順の例を示す手順図である。

【図13】本発明の実施例におけるピットマップからポ リゴン図形への変換を説明する図である。

【図14】本発明の実施例におけるピットマップからポ リゴン図形への変換手順の例を示す手順図である。

【図15】本発明の実施例における図形の重なり、図形 間の間隔の検出手順の例を説明する図である。

【図16】本発明の実施例における図形の重なり、図形 間の間隔の検出手順の例を示す手順図である。

【図17】本発明の実施例における図形の最小幅の検出 手順の例を説明する図である。

【図18】本発明の実施例における図形の最小幅の検出 手順の例を示す手順図である。

【図19】配線パターンの断線、短絡の例を示す概念図 である。

【図20】本発明の実施例における配線パターンの短 絡、断線の検出に用いられるテーブルの例を説明する図 である。

【図21】本発明の実施例における配線パターンの短 絡、断線の検出手順の例を示す手順図である。

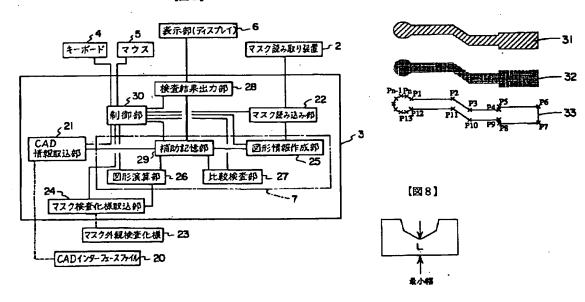
14

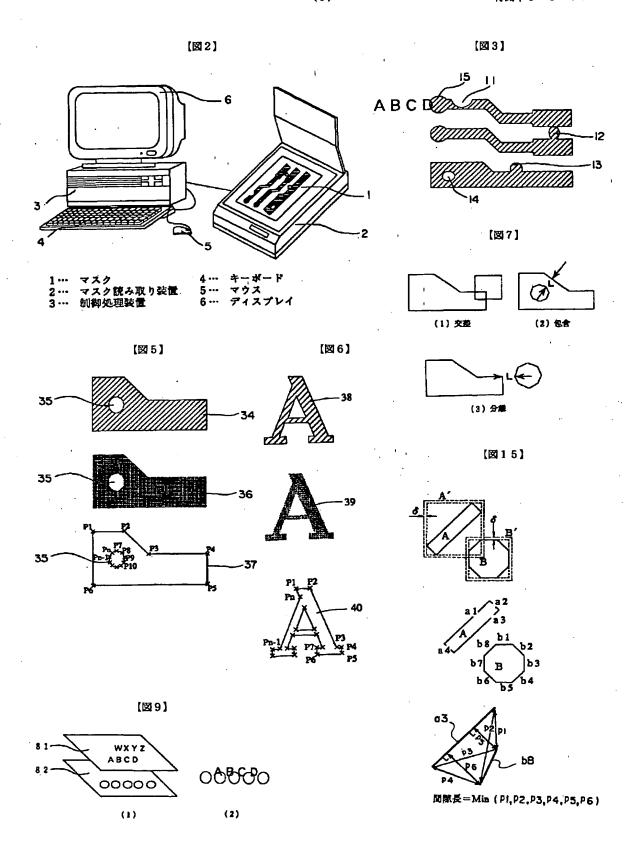
【符号の説明】

- 1 マスク
- 2 マスク読み取り装置
- 制御処理装置
- 4 キーポード
- マウス
- 6 デスプレイ
- 10 11 マスクの欠け
  - 12 短絡
  - 13 マスクの突起
  - 14 マスクのピンホール
  - 15 シルクの垂れ込み
  - 20 CADインターフェースファイル
  - 21 CAD情報取込部
  - 22 マスク読み込み部
  - 23 マスク外観検査仕様
  - 24 マスク検査仕様取込部
- 25 図形情報作成部
- - 26 図形演算部
  - 27 比較檢查部
  - 28 検査結果出力部
  - 29 補助記憶部
  - 30 制御部
  - 31, 34, 38 マスクパターン
  - 32, 36, 39 ピットマップパターン
  - 33, 37, 40 ポリゴン図形パターン
  - 35 スルーホール

【図1】

[図4]





【図11】

假骨

**S** 1

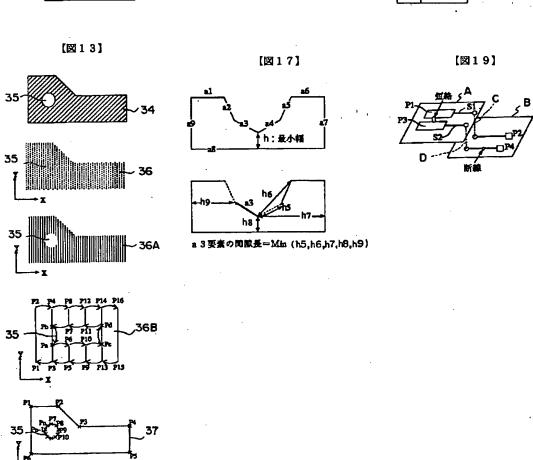
S2 P3

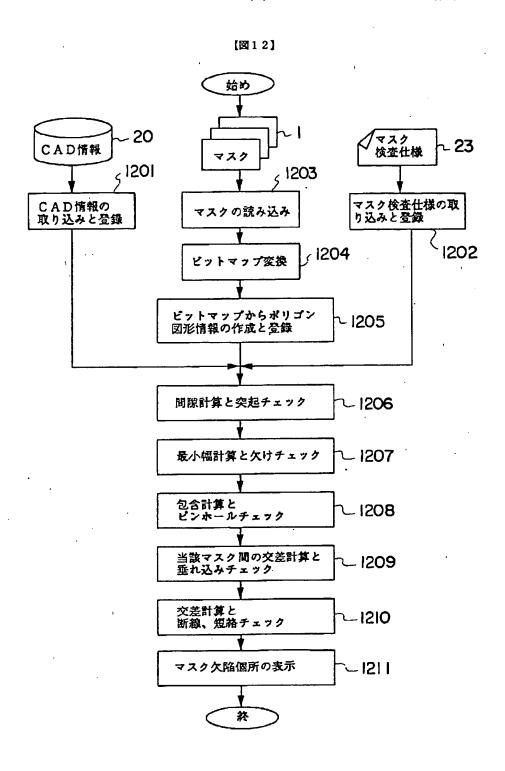
袋袋点

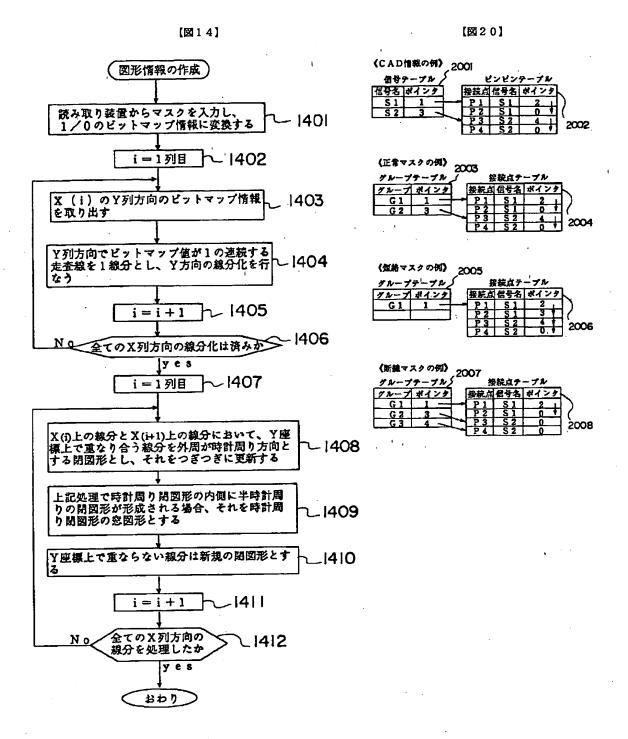
P1, P2

~1108

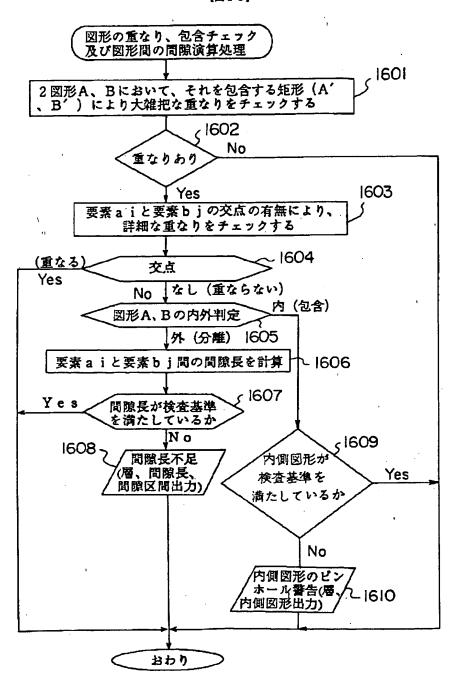
[図10] CAD情報 1001 1002 1102 半田面 1003 接技点 热糖点 接続点 P1, P2 P1, P2 P1, P2 **S** 1 P3. P4 [図13] [図17]



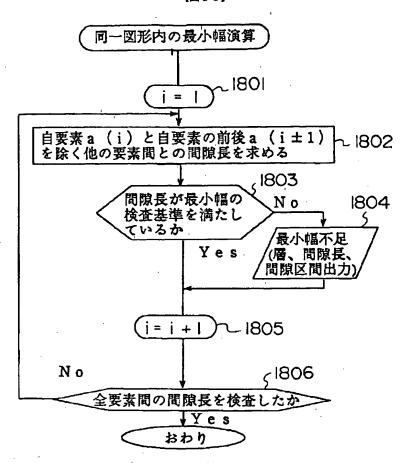




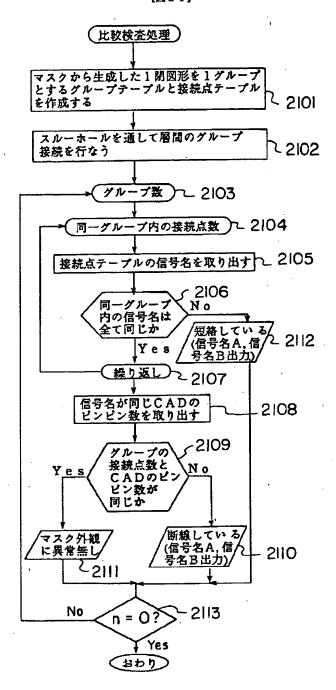
【図16】



[図18]



[图21]



フロントページの続き

(72)発明者 畠山 一実 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.